

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日

2005年9月1日 (01.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号

WO 2005/081292 A1

(51) 国際特許分類⁷:

H01L 21/027, G03F 7/20

(74) 代理人: 志賀 正武, 外 (SHIGA, Masatake et al.); 〒1048453 東京都中央区八重洲2丁目3番1号 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/002461

(22) 国際出願日:

2005年2月17日 (17.02.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-045102 2004年2月20日 (20.02.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 白石 健一 (SHIRAISHI, Kenichi) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP).

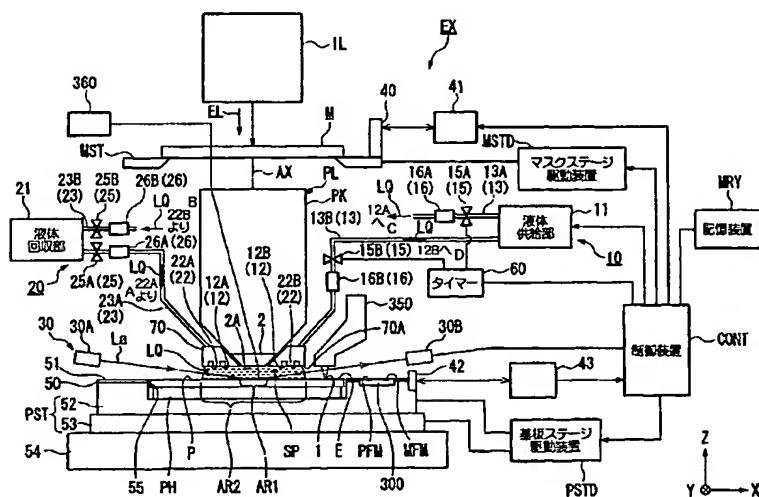
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

[締葉有]

(54) Title: EXPOSURE APPARATUS, SUPPLY METHOD AND RECOVERY METHOD, EXPOSURE METHOD, AND DEVICE PRODUCING METHOD

(54) 発明の名称: 露光装置、供給方法及び回収方法、露光方法、ならびにデバイス製造方法





IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), 2文字コード及び他の略語については、定期発行される
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
MR, NE, SN, TD, TG). のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:
— 國際調査報告書

head section of the projection optical system (PL) and the substrate (P) facing the optical element (2), a timer (60) for measuring the elapsed time after the liquid supply by the liquid supply mechanism (10) is started, and a control device (CONT) for determining, based on the result of measurement by the timer (60), whether or not a space (SP) including at least the light path of the exposure light (EL) between the optical element (2) and the substrate (P) has been filled with the liquid (LQ).

(57) 要約: 露光精度及び計測精度の劣化を防止できる露光装置を提供する。露光装置 (EX) は、投影光学系 (PL) と液体 (LQ) とを介して基板 (P) に露光光 (EL) を照射して基板 (P) を露光するものであって、投影光学系 (PL) の像面側先端部の光学素子 (2) とその光学素子 (2) に対向する基板 (P) との間に液体 (LQ) を供給する液体供給機構 (10) と、液体供給機構 (10) による液体供給が開始されてからの時間を計測するタイマー (60) と、タイマー (60) の計測結果に基づいて、光学素子 (2) と基板 (P) との間の少なくとも露光光 (EL) の光路を含む空間 (SP) が液体 (LQ) で満たされたか否かを判断する制御装置 (CONT) とを備えている。